



创新领域镀膜设备

The Thin Film Company

www.fhr.biz

公司简介

FHR是薄膜镀膜设备代工厂及服务供应商中的领导者，涉及工艺包括磁控溅射，热蒸发和电子束蒸发，PECVD以及ALD。

自1991年以来，FHR已向全球客户交付了250多台设备，并为研发，试生产和大批量制造提供支持。

通过模块化组装工艺，每一枚叶式，箱式，在线式或是卷绕式设备都可根据客户需求量身定制。



作为先导集团的一部分，FHR为全球客户提供一站式工程、设备、耗材、服务和回收方案。

FHR值得您信赖。与FHR合作让您下一个项目变得简单，成果更上一层楼。

制程技术

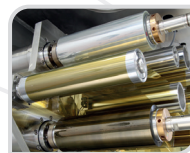
Physical Vapor Deposition 物理气相沉积	Chemical Vapor Deposition 化学气相沉积	Dry Etching 干法刻蚀
<ul style="list-style-type: none"> ▲ Magnetron sputtering 磁控溅射 ▲ Thermal and e-beam evaporation 热蒸发和电子束蒸发 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Plasma-enhanced CVD 等离子增强化学气相沉积 ▲ Atomic layer deposition 原子层沉积 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Plasma etching 等离子体刻蚀 ▲ Reactive ion etching 反应离子刻蚀

应用领域





产品系列



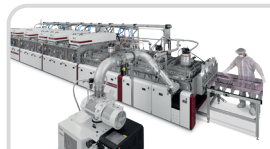
FHR Roll

溅射、蒸发和PECVD设备，适用于柔性基材，如金属箔或聚合物膜（适用于大批量制造，试生产，及作为研发工具）。



FHR Line

使用溅射，蒸发以及PECVD技术，适用于刚性，平整以及小而形状各异的基材（适用于大批量制造，试生产，及作为研发工具）。



FHR Boxx

单腔室磁控溅射设备（鼓载设备），用于小规模生产中的磁控溅射（适用于多种基材形状—平面或三维部件）。



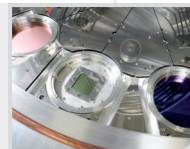
FHR Star

真空镀膜设备，可以自由组装工艺模块，用于溅射、热蒸发镀膜、等离子增强化学气相沉积、原子层沉积、刻蚀和退火等工艺。



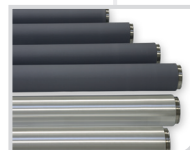
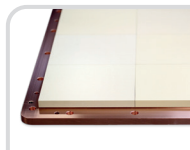
FHR Star.EOSS 系列

真空镀膜设备，用于超高精度光学干涉膜（光学滤镀膜厚最均匀，基材直径可达200-300mm）用于超高精度光学干涉膜(光学滤镜)



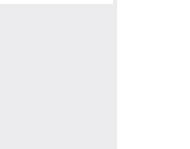
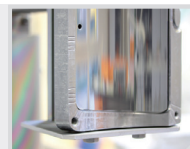
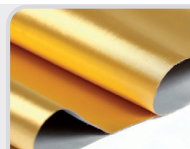
FHR 溅射靶材 & 粘合服务

旋转和平面溅射靶材，可选绑定于冷背板或冷体上。



FHR 镀膜服务 & 样品镀膜

服务于小批量生产和用于薄膜设备性能测试的样品制备。



FHR 客户服务

由我司经验丰富的售后工程师为客户提供卓越的技术服务。





FHR Anlagenbau GmbH

Am Hügel 2
01458 Ottendorf-Okrilla (德国)
电话 +49 35205520-0
电子邮箱: postbox@fhr.de
网址: www.fhr.biz



有时我们必须另辟蹊径，为客户量身定制关于设计和制造方面的解决方案。我们热衷于个性化订制。如需更多详情，请联系我们。



www.fhr.biz